PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

2001-308165

(43)Date of publication of application: 02.11.2001

(51)Int.Cl.

H01L 21/68 C23C 16/458 H01L 21/3065 // H01L 21/205

(21)Application number : 2000-118582

(71)Applicant: SUMITOMO OSAKA CEMENT CO

LTD

(22)Date of filing:

19.04.2000

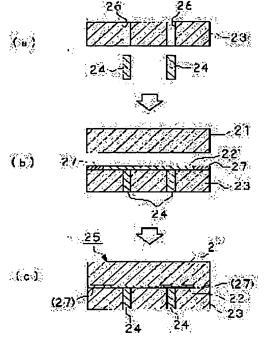
(72)Inventor: INAZUMACHI HIROSHI

(54) SUSCEPTOR AND ITS MANUFACTURING METHOD

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To obtain an electrode built-in susceptor which is superior in corrosion-resistance and plasma-resistance.

SOLUTION: A mounting plate 21 and a support plate 23 are manufactured, a fixing hole 26 is formed in this support plate 21, a power supplying terminal 24 is inserted into this fixing hole 26 so as to pierce the support plate 23, and next a conductive material layer is formed on this support plate 23 so as to come into contact with the power supplying terminal 24. In a region excluding a region forming the conductive material layer on the support plate, an insulation material layer 27 composed of the same composition as a material constituting the mounting plate 21 and the support plate 23, or the same material powder as that in the major component is formed. The support plate 23 and the mounting plate 21 are superimposed via the conductive material layer and the insulation material layer 27, and are subjected to a heat processing under pressurization,



thereby integrating them. Also, an internal electrode 22 composed of the conductive material layer is formed or arranged to manufacture an electrode built-in susceptor.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

04.12.2002

[Date of sending the examiner's decision of

04.07.2006

rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision 2006-016813 of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's 03.08.2006 decision of rejection]

[Date of extinction of right]

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2001-308165 (P2001-308165A)

(43)公開日 平成13年11月2日(2001.11.2)

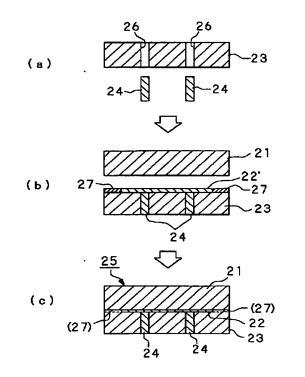
(51) Int.Cl.7	酸別記号	FΙ	テーマコート*(参考)
H 0 1 L 21/68		H01L 21/68	R 4K030
C 2 3 C 16/458		C 2 3 C 16/458	5 F 0 0 4
H 0 1 L 21/306	5	H 0 1 L 21/205	5 F O 3 1
// H 0 1 L 21/205		21/302	B 5F045
		審査請求 未請求 請	が現の数2 OL (全 6 頁)
(21)出願番号	特願2000-118582(P2000-118582)	(71)出願人 000183266	
		住友大阪セ	メント株式会社
(22)出顧日 平成12年4月19日(2000.4.19) 東京都		東京都千代	田区六番町六番地28
		(72)発明者 稲妻地 推	i
		千葉県船橋	市豊富町585番地 住友大阪セ
		メント株式	会社新規技術研究所内
		(74)代理人 100064908	
		弁理士 志	賀正武(外6名)
		Fターム(参考) 4KO3O GAO2 KA46	
		5F004	AA13 BB15 BB26 BB29
		5F031	CA02 CA05 HA02 HA03 HA17
			MA28 MA32
		5F045	AA08 EH04 EH08 EK09 EM09

(54) 【発明の名称】 サセプタ及びその製造方法

(57)【要約】

【課題】 耐腐食性および耐プラズマ性に優れた電極内 蔵型サセプタを得る。

【解決手段】 戦置板21及び支持板23を作製し、次いでこの支持板21に固定孔26を形成し、次いで、この固定孔26に給電用端子24を、支持板23を貫通するようにしてはめ込み、次いで、この支持板23上に、給電用端子24に接するように、導電材層を形成して、次いで、支持板上の、前記導電材層の形成領域以外の領域に、前記戦置板21と支持板23を構成する材料と同一組成または主成分が同一の材料粉末からなる絶縁材層27を形成し、次いで、前記導電材層と絶縁材層27を介して支持板23と戦置板21とを重ね合わせ、加圧下にて熱処理することによりこれらを一体化すると共に、前記導電材層からなる内部電極22を形成または配設して、電極内蔵型サセプタを製造する。



2

【特許請求の範囲】

1

【簡求項2】 セラミックス焼結体から板状の戦置板及び支持板を作製し、次いでこの支持板に固定孔を形成し、次いで、この固定孔に給電用端子を、支持板を貫通するようにしてはめ込み、次いで、この給電用端子を保持する支持板上に、給電用端子に接するように、内部電極となる導電材層を形成し、次いで、支持板上の、前記導電材層の形成部分以外の領域に、前記戦置板と支持板を構成する材料と同一組成または主成分が同一の材料粉末からなる絶縁材層を形成し、次いで、前記導電材層と絶縁材層を介して支持板と戦置板とを重ね合わせ、加圧 20下にて熱処理することによりこれらを一体化すると共に、これらの支持板と戦置板との間に、前記導電材層からなる内部電極を形成または配設することを特徴とする電極内蔵型サセプタの製造方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、サセプタ及びその 製造方法に関し、特に、耐腐食性、耐プラズマ性に優れ た電極内蔵型のサセプタ、及び該サセプタを歩留まりよ く廉価に製造することが可能なサセプタの製造方法に関 30 する。

[0002]

【従来の技術】近年、IC、LSI、VLSI等の半導体の製造工程において使用されるドライエッチング装置や、CVD装置等においては、エッチングやCVDによる成膜をウエハ毎に均一に行うため、半導体ウエハ、液晶基板ガラス、プリント基板等の板状試料を、1枚ずつ処理する枚葉化がすすんでいる。この枚葉化プロセスにおいては、板状試料を1枚ずつ処理室内に保持するために、この板状試料をサセプタと称される試料台(台座)に戦置し、所定の処理を施している。このサセプタは、プラズマ中での使用に耐え、かつ髙温での使用に耐え得る必要があることから、耐プラズマ性に優れ、熱伝導率が大きいことが要求される。このようなサセプタとしては、耐プラズマ性、熱伝導性に優れたセラミックス焼桔体からなるサセプタが使用されている。

【0003】このようなサセプタには、その内部に電荷を発生させて静電吸着力で板状試料を固定するための静電チャック用電極、通電発熱させて板状試料を加熱するためのヒータ電極、高周波電力を通電してプラズマを発 50

生させてプラズマ処理するためのプラズマ発生用電極等 の内部電極を配設した電極内蔵型サセプタがある。

[0004]

【発明が解決しようとする課題】従来、このような電極内蔵型サセプタとしては、例えば、図3に示されるような構造のものが知られている。図3に示すサセプタ5は、板状試料を載置するための載置板1と、この載置板1を支える支持板3と、前記載置板1と前記支持板3とを接合一体化すると共に、内部電極とされる導電性接合剤層2と、この導電性接合剤層2に接するように、前記支持板3に埋設され、電流を導電性接合剤層2内に供給する給電用端子4、4とからなる。前記載置板1は、絶縁性セラミックス焼結体製の誘電体からなり、前記支持板3は、絶縁性セラミックス焼結体製の整状基体からなり、前記導電性接合剤層2は、有機物または金属から構成されている。

【0005】しかしながら、この種の電極内蔵型サセプタ5においては、上述のように、前記載置板1および支持板3とが、異なる材料からなる導電性接合剤層2により接合されるものであるので、載置板1と支持板3との接合が不十分となり、これらの境界面から腐食性のガスやプラズマが侵入し、内部電極2がガスやプラズマにさらされたり、載置板1と支持板3との接合界面が破壊されるなどの虞があり、サセプタ5の耐腐食性、耐プラズマ性が充分でないという問題があった。このような問題を解決するために、従来のサセプタ5の製造方法においては、載置板1と支持板3との接合を確実とし、接合部にガスやプラズマ等が侵入しないようにする必要があった。

【0006】例えば、図4および図5に示されるように、前記載置板11を、その側周縁部にリング状のフランジ11aを設け、これにより円盤状の凹部11b内に、導電性接合層12、および給電用端子14、14が埋設された支持板13を組み込む方法が考えられた。しかしながら、このような方法においては、載置板11を上記の構造の形状にするとともに、導電性接合層12および支持板13を、載置板11の凹部11bに隙間なく、嵌合するような形状に設計しなくてはならず、そのために、サセプタ15の製造工程が煩雑になるという問題があった。

【0007】本発明は前記事情に鑑みてなされたものであり、その目的は、載置板と支持板との接合面から、サセプタ内部に、腐食性のガスやプラズマ等の侵入がなく、耐腐食性および耐プラズマ性に優れた電極内蔵型サセプタを得るとともに、このような電極内蔵型サセプタを容易に得ることができるサセプタの製造方法を得ることである。

[0008]

【課題を解決するための手段】本発明者らは、上記課題

解決のため鋭意検討した結果、特定組成の材料により載 置板及び支持板を形成し、これらを加圧下で熱処理して 一体化するとともに、このときに、載置板と支持板との 境界部に絶縁層を介在させることによって、上記課題を 効率よく解決し得ることを知見し、本発明を完成するに 至った。即ち、第1の発明においては、板状試料を載置 するセラミックス焼結体製の載置板と、この載置板を を支持板との間に設けられ、外部と接しないように設け られた内部電極と、この内部電極に接するように前記支 持板に貫通して設けられた給電用端子とからなり、前記 戦置板と前記支持板とが、これらを構成する材料と同一 組成または主成分が同一の絶縁性材料により接合一体化 されてなることを特徴とする電極内蔵型サセプタを提供 する。

【0009】第2の発明においては、セラミックス焼結体から板状の戦យ板及び支持板を作製し、次いでこの支持板に固定孔を形成し、次いで、この固定孔に給電用端子を、支持板を質通するようにしてはめ込み、次いで、この給配用端子を保持する支持板上に、給電用端子に接づるように、内部電極となる導電材層を形成し、次いで、支持板上の、前記導電材層の形成部分以外の領域に、前記戦យ板と支持板を構成する材料と同一組成または主成分が同一の材料粉末からなる絶縁材層を形成し、次いで、前記導電材層と絶縁材層を介して支持板と戦យ板とを重ね合わせ、加圧下にて熱処理することによりこれらを一体化すると共に、これらの支持板と戦យ板との間に、前記導電材層からなる内部電極を形成または配設することを特徴とする電極内蔵型サセプタの製造方法を提供する。

[0010]

【発明の実施の形態】以下、発明の実施の形態を掲げ、本発明を詳述する。なお、この発明の実施の形態は、特に限定のない限り発明の内容を制限するものではない。図1は、本発明のサセプタの一例を示したものである。サセプタ25は、板状試料を載置する載置板21と、この戦置板21と一体化される支持板23と、この戦置板21と支持板23との間に形成された内部電極22と、この内部電極22に通じ、前記支持板23内部に質通するようにして設けられた給電用端子24、24とからな40る。そして、上記載置板21と上記支持板23とは、これらを構成する材料と同一組成または主成分が同一の絶縁材料によりなる絶縁材層(27)によって接合一体化されてなるものである。

【0011】上記載置板21及び支持板23は、その重ね合わせ面の形状を同じくし、ともに、アルミナ基焼結体や窒化アルミニウム基焼結体などの絶縁性セラミックス焼結体からなるものである。前記のアルミナ基焼結体や窒化アルミニウム基焼結体としては、特に限定されるものではなく、一般に市販されているものでよい。ま

た、前記アルミナ基焼桔体や窒化アルミニウム基焼結体は、焼結性や耐プラズマ性を向上させるために、イットリア(Y_2O_3)、カルシア(C_aO)、マグネシア(M_gO)、炭化珪素(S_iC)、チタニア(T_iO_2)から選択された 1 種または 2 種以上を合計で 0. $1\sim 1$ 0. 0 重最%含有するようにしてもよい。

【0012】前記絶縁材層(27)は、上記載置板21と支持板22との境界部、すなわち内部電極22形成部以外の外周部領域を接合するために設けられたものであり、上記載置板21及び支持板23と同一あるいは主成分が同一の粉末絶縁材料からなるものである。ここに、「主成分が同一の材料」とは、上記載置板21と上記支持板23を構成する材料以外の材料の含有量が50重量%以下である材料をいい、例えば、上記載置板21と上記支持板23とが窒化アルミニウムで構成される場合、窒化アルミニウム以外の成分が50重量%以下である材料をいう。

【0013】上記内部電極22は、電荷を発生させて静電吸着力で板状試料を固定するための静電チャック用電極、通電発熱させて板状試料を加熱するためのヒータ電極、高周波電力を通電してプラズマを発生させてプラズマ処理するためのプラズマ発生用電極等として用いられるもので、その用途によって、その形状や、大きさが適宜調整される。この内部電極22は、アルミナータンクステン複合導電性材料、アルミナータングステン複合導電性材料、アルミナー炭化珪素複合導電性材料、窒化アルミニウムータングステン複合導電性材料、窒化アルミニウムータングステン複合導電性材料等の導電性セラミックス、またはタングステン、タンタル、モリブデン等の高融点金属から形成されている。

【0014】上記給電用端子24,24は、内部電極22に電流を供給するために設けられたもので、その数、形状、大きさ等は、内部電極22の形状と、態様(即ち静電チャック用電極、ヒータ電極、プラズマ発生電極等のいずれのタイプの内部電極22とするか)により決定される。この給電用端子24は、上記の内部電極22を形成している導電性セラミックス粉末を加圧焼結した複合導電性焼結体からなるか、タンタル、モリブデン等の高融点金属から形成されている。

【0015】次に、このようなサセプタ25の製造方法を説明する。図2は、サセプタ25の製造工程を示したものである。まず、アルミナ基焼結体や窒化アルミニウム基焼結体などの絶縁性セラミックス焼結体から板状の戦置板21及び支持板23を作製する。この場合、前記絶縁性セラミックス焼結体の粉末を所望の形状に成型、焼結することによって載置板21及び支持板23を得ることができる。このとき、好ましくは、載置板21の片面(板状試料の載置面)を平坦度が10μm以下となるように研磨する。

【0016】次いで、上記支持板23に、予め給電用端

子24,24を組み込み保持するための固定孔26,26を形成する。この固定孔26,26の穿設方法は、特に制限されるものでなく、例えば、ダイヤモンドドリルによる孔あけ加工法、レーザ加工法、放電加工法、超音波加工法を用いて穿設することができる。また、その加工精度は、通常の加工精度でよく、歩留まりはぼ100%で加工できる。なお、固定孔26,26の穿設位置及び数は、内部電極22の態様と形状より決定される。

【0017】次いで、給電用端子24を、上記支持体23の固定孔26に密葡固定し得る大きさ、形状となるように作製する。給電用端子24の作製方法としては、給電用端子24を複合導電性焼結体製とする場合には、導電性セラミックス粉末を、所望の形状に成形して加圧焼結する方法等があげられる。このとき、給電用端子24に用いられる導電性セラミックス粉末は、サセプタ25に形成される内部電極22と同様のものからなることが好ましい。また、給電用端子24を金属製とする場合には、高融点金属を用い、研削法、粉末治金等の従来公知の金属加工法などにより形成する。この給電用端子24の加工精度は、後の加圧熱処理で再焼成して固定されるので、日本工業規格(JIS)の標準公差レベルでクリアランスをもっていてもよい。

【0018】次に、作製した給電用端子24,24を、支持板23の固定孔26,26に嵌め込む。次に、給電用端子24,24が組み込まれた支持板23の表面の所定領域に前配給電用端子24,24に接触するように、上記の導電性セラミックス等の導電材料粉末を、エチルアルコール等の有機溶媒に分散した内部電極形成用塗布剤を塗布し、乾燥して内部電極形成層22,を形成する。このような塗布液の塗布方法としては、均一な厚さに塗布する必要があることから、スクリーン印刷法等を用いることが望ましい。また、他の方法として、上記の離点金属の蒸着膜等の薄膜を形成する方法や、上記の導電性セラミックスや高融点金属の薄板を配設して内部電極形成層22,とする方法等がある。これらの薄膜や薄板を配設する場合には、これらと給電用端子24、24と強固に接触させておく必要がある。

【0019】また、支持板23上の内部電極形成層22'を形成した領域以外の領域に、絶縁性、耐腐食性、耐プラズマ性を向上させるために、上記載配板22と上40記支持板23とを構成する材料と同一組成または主成分が同一の粉末材料を含む絶縁材層27を形成する。この絶縁材層27を形成するには、例えば、上記載置板21と上記支持板23とがアルミナ焼結体で形成されているときはアルミナ粉末をエチルアルコール等の有機溶媒に分散した盤布剤、上記載置板21と上記支持板23とが窒化アルミニウム焼結体で形成されているときは窒化アルミニウム粉末をエチルアルコール等の有機溶媒に分散した強布剤を、上記所定部位にスクリーン印刷などで塗布し、乾燥する。50

6

【0020】次に、内部電極形成層22'及び絶縁材層27を形成した支持板23上に、該内部電極形成層22'及び絶縁材層27を介して、載置板21を重ねた後、これらを加圧下にて熱処理して一体化する。このような製造方法においては、前記支持板23と、前記載置板21との間に、有機物や金蔵からなる接合剤を介在させることなく、加圧下での熱処理のみで、載置板21と支持板23との接合一体化を達成することができる。このときの熱処理の条件としては、熱処理雰囲気は真空、Ar、He、N2などの不活性雰囲気であるのが好ましい。加圧力は5~10MPaが望ましく、また、熱処理温度は1600~1850℃が望ましい。

【0021】そして、このとき、支持板23上に形成された内部電極形成層22'が導電性セラミックス粉末等の導電材料からなる場合には、内部電極形成層22'は焼成されて、複合導電性焼結体製の内部電極22とされる。また、上記支持板21及び載置板23は、上記絶縁材層27を介して接合一体化される。また、上記給電用端子24,24は、加圧下での熱処理で再焼成して支持板23の固定孔26,26に固定される。

【0022】このようなサセプタの製造方法によれば、 載置板21と支持板23との接合面に、これらを構成す る材料と同一組成または主成分が同一の絶縁性材料から なる絶縁材層27が設けられて、この絶縁材層27によ り、載置板21と支持板23とが接合一体化されため、 載置板21と支持板23との接合界面から、ガスやプラ ズマ等がサセプタ25内部に侵入するなく、内部電極2 2がこれらにさらされることことない。よって、載置板 21と支持板23との接合界面が破壊されることなく、 また、内蔵された内部電極22が異常放電や破壊などを 起こすことがないので、サセプタ25の耐腐食性、耐プ ラズマ性を向上させることができる。さらに、このよう なサセプタ25の製造方法によれば、上記支持板23と 上記載置板21とが、絶縁材層27により良好に接合一 体化されるものであるので、従来のように、これらの形 状に特別な工夫を必要とせず、簡単な板状形状とするこ とができるので、サセプタ25を歩留まりよく廉価に製 造することができる。

[0023]

【実施例】以下、本発明を実施例を示して詳しく説明する.

(実施例1)以下、内部電極22を静電チャック用電極 とした場合の実施例を掲げ、本発明を更に詳述する。

「給電用端子の作製」アルミナ粉末(平均粒径0.2 μ m、大明化学工業(株)製)40重量部、タンタルカーバイト粉末(平均粒径1 μ m、日本新金属(株)製)60重量部、イソプロピルアルコール150重量部とを混合し、更に遊星型ボールミルを用いて均一に分散させてスラリーを得た。このスラリーから、アルコール分を、吸引ろ過して除去し、乾燥してアルミナータンタルカー

バイト複合粉末を得た。次に、上記複合粉末を成型、焼結し、直径2.5 mm、長さ5 mmの棒状アルミナータンタルカーバイト複合導電性焼結体を得、これを給電用端子24とした。焼結は温度1700℃、圧力20MPaの条件でホットプレスによる加圧焼結を行った。焼結後のアルミナータンタルカーバイト複合導電性焼結体の相対密度は98%以上であった。

【0024】「支持板の作製」アルミナ粉末(平均拉径 0.2 μm、大明化学工業(株)製)を成型、焼結し、直径230mm、厚さ5mmの円盤状アルミナ焼結体(支持板23)を得た。焼結時の条件は、上記給電用端子24の作製時と同様とした。次いで、このアルミナ焼結体に、給電用端子24,24を組み込み、固定するための固定孔26,26を、ダイヤモンドドリルによって孔あけ加工することにより穿設し、アルミナ焼結体製の支持板23を得た。

【0025】「峨置板の作製」上記アルミナ基焼結体製の支持板23の作製方法に準じて、直径230mm、厚さ5mmの円盤状アルミナ基焼結体を得た。次いで、この円盤状アルミナ基焼結体の一面(板状試料の戦置面)を平坦度が10μm以下となるよう研磨し、アルミナ基焼結体製の戦置板21を得た。

【0026】「一体化」上記支持板23に穿設された前

記固定孔26,26に、前記の給電用端子24,24を

押し込み、組み込み固定した。次いで、図2-(b)に 示すように、この給電用端子24,24が組み込み固定 された支持板23上に、後の加圧下での熱処理工程で内 部電極22となるよう、40重畳%のアルミナ粉末と6 0 重量%のタンタルカーバイト粉末を含む、アルミナー タンタルカーパイト複合導電性材料からなる塗布剤を、 スクリーン印刷法にて印刷塗布し、乾燥して、内部電極 形成層22'を形成した。次いで、支持板23上の上記 内部電極22形成領域以外の領域に、アルミナ粉末 (平 均拉径 0. 2 μm、大明化学工業(株) 製)と、エチル アルコールを含む塗布剤を、スクリーン印刷法にて印刷 **逸布し、乾燥して、絶縁材層27を形成した。次いで、** 図2-(c)に示すように、この内部電極形成層22' (印刷面)及び絶縁材層27を挟み込むように、また、 前記戦置板21の研摩面が上面となるように、前記支持 板23と載置板21とを重ね合わせて、ホットプレスに 40 て加圧下にて熱処理して一体化して実施例1のサセプタ 25を作製した。このときの加圧、熱処理条件は、温度 1750℃、圧力7.5MPaの条件にて行った。

【0027】「評価」このようにして作製されたサセプ 夕25の接合断面をSEM観察したところ、前記載置板 21と、前記支持板23と、前記給電用端子24,24 とは良好に接合されていた。また、この実施例としての 電極内蔵サセプタ25をCF4ガスとO2ガスとの混合ガスのプラズマ中に15時間曝した後、サセプタ25表面の性状を目視観察し、また、サセプタ25の板状試料載置面の表面粗さの変化、吸着力の変化を測定したところ、表面性状に変化は認められず、また、表面粗さももど変化せず(試験前Ra=0.12μm、試験後Ra=0.13μm)、吸着力も変化しない(試験前:0.03MPa、試験後0.03MPa)ことから、耐腐食性、耐プラズマ性が極めて良好であることが判明した。【0028】(比較例)上記の絶縁材層27を介在させなかった他は実施例に準じて、比較例としての電極内底サセプタを作製した。この電極内蔵サセプタの耐腐食性、耐プラズマ性を実施例に準じて試験したところ、接合面が腐食して内部電極へのプラズマ侵入により異常放電が起こり、耐腐食性、耐プラズマ性が劣ることが判明

[0029]

した。

【発明の効果】以上説明したように、本発明のサセプタによれば、載置板と支持板との接合面から、腐食性のガスやプラズマの侵入がないので、これらの接合界面が破壊されることがなく、また内部電極が前記ガスやプラズマにさらされることがないので、耐腐食性、耐プラズマ性に優れる。また、本発明のサセプタの製造方法によれば、載置板と支持板との境界面に、絶縁材層を設けてこれらを接合一体化するものであるので、耐腐食性、耐プラズマ性に優れたサセプタを容易に得ることができる。また、載置板及び支持板を複雑な形状にする必要がなく、単なる板状体とすることができるので、サセプタを歩留まりよく、廉価に製造することができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】 本発明のサセプタの一例を示す断面図である。

【図2】 (a) (b) (c) 本発明のサセプタの製造 方法の一例を示す工程図である。

【図3】 従来のサセプタの一例を示す断面図である。

【図4】 従来のサセプタの一例における載置板および 支持板の形状を示す断面図である。

【図5】 従来のサセプタの一例における載置板および 支持板の形状を示す断面図である。

ο 【符号の説明】

- 21 載置板
- 22 内部電極
- 23 支持板
- 24 給電用端子
- 25 サセプタ
- 26 固定孔
- 27 絶縁材層

8

